

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年5月11日(2006.5.11)

【公開番号】特開2004-294564(P2004-294564A)

【公開日】平成16年10月21日(2004.10.21)

【年通号数】公開・登録公報2004-041

【出願番号】特願2003-83914(P2003-83914)

【国際特許分類】

G 02 B	5/08	(2006.01)
G 02 B	5/26	(2006.01)
G 02 B	5/28	(2006.01)
C 01 B	33/12	(2006.01)
C 01 F	7/36	(2006.01)
C 01 G	1/02	(2006.01)
C 01 G	23/04	(2006.01)

【F I】

G 02 B	5/08	A
G 02 B	5/26	
G 02 B	5/28	
C 01 B	33/12	C
C 01 F	7/36	
C 01 G	1/02	
C 01 G	23/04	C

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月22日(2006.3.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0002】

【従来の技術】

低屈折率を示す二酸化ケイ素の薄膜および高屈折率を示す二酸化チタンや酸化アルミニウムなどの金属酸化物の薄膜は、各種光学製品の多層反射膜、反射防止膜、フォトニック結晶などの用途に利用されている。